智慧財產法院民事裁定

109年度民專抗字第8號

抗　告　人　凌嘉科技股份有限公司

法定代理人　陳連春

代　理　人　陳冠宏律師

　　張瑜庭律師

　　張容珉律師

相　對　人　台灣積體電路製造股份有限公司

法定代理人　劉德音

上列當事人間保全證據事件，抗告人對於中華民國109 年3 月31日本院109 年度民聲字第11號裁定提起抗告，本院裁定如下：

主　文

原裁定除確定部分外廢棄。

准許抗告人就相對人台灣積體電路製造股份有限公司先進封測三廠（地址：桃園市○○區○○○路○○○ 號）之友威科技股份有限公司產製的「水平連續式濺鍍系統」成品，以照相、攝影或其他必要方式進行現場勘驗；並就該「水平連續式濺鍍系統」之合約書、規格書、說明書、使用（或操作）手冊、圖面、型錄、規劃建議書、報價單等相關資料，以照相、攝影、拷貝電磁紀錄、影印、電腦列印或其他必要方式予以保全。

聲請（除確定部分外）及抗告訴訟費用由相對人負擔。

理　由

一、聲請及抗告意旨略以：抗告人為註冊第I513840 號「多層膜的量產方法」」發明專利（下稱系爭發明專利）及註冊第M499418 號「連續型同步鍍膜設備」新型專利（下稱系爭新型專利，下合稱系爭專利）之專利權人，並以系爭專利開發「

連續型真空濺鍍設備」產品，參與相對人台灣積體電路製造股份有限公司（下稱台積電公司）104 年真空濺鍍設備之競標，最後相對人台積電公司決定使用友威科技股份有限公司（下稱友威公司）之「水平連續式濺鍍系統」（下稱系爭設備）作為測試機種，並於同年9 、10月左右進廠。然由友威公司提供給相對人台積電公司的系爭設備簡報（下稱聲證4 簡報），及友威公司對外銷售的簡報資料（下稱聲證6 簡報），可看出系爭設備有高度侵害系爭專利之可能。而系爭設備僅特定半導體廠商會購買，單價甚高，體積龐大，非一般市場自由流通之商品，抗告人無從取得，且相對人台積電公司「使用」系爭設備亦有侵權之虞，恐有嗣後配合友威公司變更系爭設備或竄改相關資料電磁紀錄之可能性，故本件證據有滅失或礙難使用之虞，亦有確定事、物現況之必要，爰依民事訴訟法第368 條之規定提出本件聲請（未繫屬本院部分不予贅述）。原審駁回抗告人之聲請，抗告人僅就相對人台積電公司部分提起抗告，抗告聲明：1.原裁定關於駁回抗告人後開第二項聲請部分廢棄。2.請准至相對人台灣積體電路製造股份有限公司先進封測三廠（地址：桃園市○○區○○○路○○○ 號）就友威科技股份有限公司產製之「水平連續式濺鍍系統」之成品以照相、攝影或其他方式進行現場勘驗；並以照相、攝影、拷貝電磁紀錄、影印、電腦列印等方式，就系爭設備之合約書、規格書、說明書、使用（或操作）手冊、圖面、型錄、規劃建議書、報價單或其他相關資料之畫面或電磁紀錄予以保全。3.抗告費用由相對人負擔（見本院卷第133 頁）。

二、按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院

聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證；保全證據之聲請，應表明下列各款事項：㈠他造當事人，如不能指定他造當事人者，其不能指定之理由。㈡保全之證據。㈢依該證據應證之事實。㈣應保全證據之理由。前項第1 款及第4 款之理由，應釋明之，民事訴訟法第368 條第1 項與第370 條分別定有明文。又民事訴訟法第368 條於89年2 月9 日增訂後段以擴大容許聲請保全證據之範圍，其立法目的在於促使主張權利之人，於提起訴訟前即得蒐集事證資料，以瞭解事實或物體之現狀，將有助於當事人研判紛爭之實際狀況，進而成立調解或和解，以消弭訴訟，達到預防訴訟之目的，此外亦得藉此賦予當事人於起訴前充分蒐集及整理事證資料之機會，而有助於法院於審理本案訴訟時發現真實及妥適進行訴訟，以達審理集中化之目的。依此立法意旨，有關證據保全，並不以該證據有滅失或礙難使用之虞為限，如為確定事、物之現狀而有法律上利益並有必要者，縱依通常情形尚無滅失或礙難使用之虞者，亦得聲請予以保全。又稱釋明者，指得用可使法院信其主張為真實且得即時調查之一切證據，使法院就某項事實之存否，得到大致為正當之心證，即為已足，此與證明，須就當事人所提證據資料，足使法院產生堅強心證，可確信其主張為真實者，尚有不同（民事訴訟法第284 條、最高法院97年度台抗字第264 號民事裁判、98年度台抗字第807 號民事裁判要旨參照）。

三、抗告人主張其為系爭專利之專利權人，系爭設備有侵害系爭專利之可能乙節，業據抗告人提出專利說明書及聲證4 、聲證6 簡報為釋明（見原審卷第35至87頁、第89至91頁、第99

至101 頁），觀諸抗告人所提出之聲證4 、聲證6 簡報，已揭露系爭設備為鍍膜設備，具有緩衝區間（Process Cooling Buffer）、鍍膜區間（Sputter Chamber)及可同時容許3個待鍍物進行鍍膜流程，且各載具在各鍍膜區間中執行鍍膜程序時，會在各鍍膜區間及前後的緩衝區間三者間移動，鍍膜係於真空環境，待鍍物應置於載具上，且須藉由傳輸機構達成移動，故聲證4 、6 已揭露系爭發明專利請求項1 、系爭新型專利請求項1 之部分技術，應認抗告人就此部分事實已盡釋明之責。就保全必要性乙節，系爭設備是提供給半導體封測商進行鍍膜作業使用，體積龐大，價格高達新臺幣（下同）四千多萬元（見原審卷第123 頁），僅有特定半導體廠商會購買，且其交易模式乃客戶提出訂單後再為製造、銷售並協助安裝，並非一般市場自由流通商品，抗告人無法自市場上取得或向友威公司購得系爭設備及購買憑證，而無法獲得系爭設備之詳細技術內容以進行專利侵權比對，亦無法證明友威公司確有實施系爭專利情事，又系爭設備現由相對人台積電公司管理使用中，相對人雖非系爭設備直接製造者，但其「使用」系爭設備亦有侵權之虞，縱日後於本案訴訟中命相對人提出系爭設備相關資料，相對人亦可能為了避免訴追而隱匿訴訟資料或變更系爭設備，以上情形均造成抗告人日後舉證之困難。因此，本件聲請並非純屬摸索性證明，抗告人確有法律上利益且有確定事、物現狀之利益及必要，雖證據保全可能影響相對人之營業秘密，惟智慧財產案件審理法設有秘密保持命令制度，以兼顧當事人之訴訟權益及營業秘密之保護。從而，本院衡酌全案情節，認抗告人聲請對相對人台積電公司保全證據實有必要性，合於法律規定，應

予准許。原審駁回抗告人此部分聲請，尚有未洽。抗告意旨指摘原裁定不當，求予廢棄，為有理由，爰由本院將原裁定廢棄，改判如主文第2 項所示。

四、據上論結，本件抗告為有理由，爰裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　6　　月　　17　　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　李維心

法　官　陳忠行

法　官　蔡如琪

以上正本係照原本作成。

本件不得聲明不服。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　6　　月　　18　　日

書記官　邱于婷